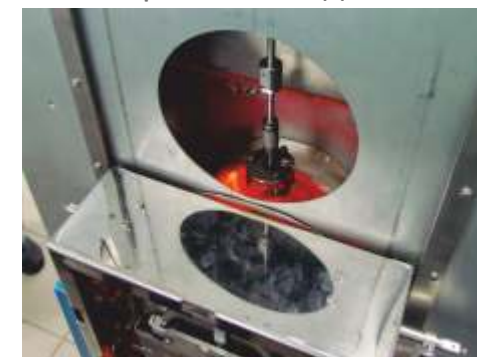


МАЛОГАБАРИТНАЯ УСТАНОВКА ПРОЦЕССОВ ДИФфуЗИИ, ОКСИЛЕНИЯ, ОТЖИГА ПОДЛОЖЕК И МАТЕРИАЛОВ ПРИ НОРМАЛЬНОМ ДАВЛЕНИИ

ОКСИД ТМ 1

Назначение: Автоматизированная термическая обработка пластин и материалов в газовой среде (оксидирование, отжиг, сушка, разгонка диффузанта, восстановление кристаллических структур) при нормальном давлении.



Особенности:

- Групповая обработка 120 пластин до \varnothing 100 мм;
- Кварцевый реактор с термостатируемой рабочей зоной;
- Диапазон рабочих температур 300-1100°C;
- Рабочие газы: N₂, O₂, H₂, HCl;
- Микропроцессорная система управления;
- Мощность потребления не более 15 кВт;
- Возможность встраивания в чистую комнату.

